【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年3月17日(2005.3.17)

【公開番号】特開2002-334860(P2002-334860A)
【公開日】平成14年11月22日(2002.11.22)
【出願番号】特願2001-136512(P2001-136512)
【国際特許分類第７版】
　Ｈ０１Ｌ　21/304
　Ｂ０８Ｂ　 3/08
　Ｇ０２Ｆ　 1/13
　Ｇ０２Ｆ　 1/1333
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　21/304　６４１
　Ｈ０１Ｌ　21/304　６４７Ｚ
　Ｈ０１Ｌ　21/304　６４８Ｇ
　Ｂ０８Ｂ　 3/08　　Ａ
　Ｇ０２Ｆ　 1/13　 １０１
　Ｇ０２Ｆ　 1/1333　５００

【手続補正書】
【提出日】平成16年4月12日(2004.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
ここで、超臨界流体とは、図３に示すように、臨界圧力Ｐｃ以上かつ臨界温度Ｔｃ以上（同図網掛け部分）で得られる物質の状態をいう。この超臨界流体は、液体と気体の中間的性質を有するため、精密な洗浄に適しているといえる。すなわち、超臨界流体は、液体に近い密度を持ち溶解性が高いため、有機成分の洗浄に有効であり、気体のように拡散性が優れるため、短時間に均一な洗浄が可能であり、気体のように粘度が低いため、微細な部分の洗浄に適しているのである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
バルブＶ１は、生成された高圧状態の超臨界二酸化炭素を基板洗浄槽５へ供給するために用いられ、加熱器４の二次側と基板洗浄槽５の一次側とを接続する配管上に設けられる。バルブＶ２は、基板洗浄槽５内を低圧にさせると共に、基板洗浄槽５での洗浄処理が終わった低圧状態の超臨界二酸化炭素を回収するために用いられ、基板洗浄槽５の二次側とバッファタンク６の一次側とを接続する配管上に設けられる。バルブＶ３は、基板洗浄槽５内を高圧にさせると共に、基板洗浄槽５での洗浄処理が終わった高圧状態の超臨界二酸化炭素を回収するために用いられ、基板洗浄槽５の二次側と減圧器７の一次側とを接続する配管上に設けられる。